

## Mikrostrukturierte Schattenmasken: Spezifikationen

- Minimale Strukturgrösse > 5µm
- Dicke der Schattenmaske = 20 - 500µm
- Material: Nickel, Nickel-Phos12, rostfrei
- Aspektverhältnis = 5 - 6 (hängt vom Mikrostruktur-Design ab)
- **EXKLUSIV: einstellbare Mikrostruktur-Flankenwinkel bis zu 15°**
- Herstellung gemäss angepasstem LiGA-Verfahren
- Mehrlagige Struktur-Architekturen möglich (Ziel: höhere Steifigkeit)
- Richtgenauigkeit Lage-zu-Lage ≤ 3µm
- Maximale strukturierte Fläche = 200 x 200mm
- Parallelität Frontseite-zu-Rückseite ≤ 10µm
- Verfügbare PVD-Beschichtung (z.B. Edelmetalle, Verschleiss-Schutz)
- Kompatibele Photoresiste für UV-Lithographie:
  - AZ Positiv-ton Resiste, MicroChem SU-8